

2021年3月20日

中国特許、実用新案の分割出願

アジア特許情報研究会:伊藤徹男

2021年2月の検索 Tips「中国特許情報の実態」の中国公開特許の推移で「遅延公開特許」として紹介したように、出願から5,6年経過しても、さらには15年以上経過してもなお公開されるものがあり、これらの遅延公開特許のほとんどは分割出願であることもわかりました。(参考①)

特許にしても実用新案にしても分割までして権利化しようというからには重要な権利に違いありません。そこで「中国特許情報の実態」で考察できなかった中国特許の分割出願について少し調べてみました。

1. 分割出願数推移

まず、2000年以降の分割出願についてその推移を見てみました。現時点(2021/3)でも2006年出願分の公開(登録)の発行が継続していますので(出願公開・登録が完結していない)、2007年以降のデータも更新のたびにわずかですが情報が変化することになります。

表1. 特許・実用新案分割案件の推移

特許分割出願					実案分割出願			
出願年	公開	登録	有効	維持率	出願年	登録	有効	維持率
2000	2,956	1,939	8	0%	2000	61	0	
2001	3,584	2,302	871	38%	2001	58	0	
2002	5,209	3,446	1,663	48%	2002	50	0	
2003	7,516	4,647	2,211	48%	2003	52	0	
2004	7,705	4,618	2,852	62%	2004	69	0	
2005	7,398	4,849	3,241	67%	2005	101	0	
2006	7,949	4,942	3,642	74%	2006	73	0	
2007	7,972	5,021	3,931	78%	2007	66	0	
2008	8,465	5,298	4,393	83%	2008	113	0	
2009	8,934	5,430	4,710	87%	2009	134	0	
2010	9,710	5,746	5,223	91%	2010	134	0	
2011	11,554	6,608	6,077	92%	2011	181	72	40%
2012	13,176	6,908	6,402	93%	2012	184	96	52%
2013	15,882	6,229	5,791	93%	2013	251	135	54%
2014	17,214	5,538	5,183	94%	2014	435	267	61%
2015	15,772	4,346	4,138	95%	2015	713	301	42%
2016	14,716	3,938	3,880	99%	2016	374	319	85%
2017	9,003	2,437	2,427	100%	2017	468	401	86%
2018	6,280	798	798	100%	2018	453	450	99%
2019	3,053	164	164	100%	2019	272	272	100%
2020	865	8	8	100%	2020	8	8	100%

表1では、有効分割特許・実案の維持率について紹介していますが、その定義は「登録分割特許に対する有効特許・実案(年金が支払われて生きているもの)」を示しています。

例えば、2001年出願の分割特許 3584 件が 2302 件登録になり、現在 871 件有効であるので、その維持率は登録分割特許に対し、38%ということです。また、分割出願までしたのに登録にならなかった（できなかつた）特許が 1282 件もあることとなります。知財出願担当であれば包袋などからその理由も突き詰めたいところでしょう。

2000 年出願特許は 20 年の有効期限を徒過しており、現時点で有効なものは 0 件のはずですがデータベースの処理上（専利権終止、年金未納など失効情報欠落のため）、極めてわずかですが生きていることになっています。

2. 出願人、分野別（IPC）推移

分割出願の推移だけを見ても得られるものは少ないと思いますので、次に出願人の動向を見てみました。2000 年以降 2019 年出願分の各年 TOP5 出願人を表 2 に示した。さらに 5 年単位の出願人 TOP10 を表 3 に、IPC TOP10 を表 4 に示した。それぞれ括弧内の数字は分割出願数です。表 2～表 4 はいずれも特許です。

表 2. 出願各年の分割出願 TOP5 出願人

2000出願(2956) 松下电器产业(202) 半导体能源研究所(84) 索尼(80) 三星电子(65) 三菱电机(56)	2005出願(7395) 松下电器产业(255) 邱则有(242) 三星电子(231) 索尼(112) 高通(100)	2010出願(9673) 索尼(263) 高通(239) 三星电子(188) 半导体能源研究所(152) 华为技术(135)	2015出願(13047) 牟少奇(502) 广东欧珀移动通信(216) 华为技术(185) 三星电子(139) 江苏理工学院(120)
2001出願(3584) 松下电器产业(241) 索尼(113) 精工爱普生(71) 日立制作所(79) 半导体能源研究所(56)	2006出願(7938) 三星电子(224) 高通(184) 邱则有(178) 松下电器产业(174) 索尼(134)	2011出願(11463) 戴梦云(558) 三星电子(255) 英特尔(244) LG电子(186) 高通(167)	2016出願(11738) 华为技术(363) 广东欧珀移动通信(235) 衢州市易凡设计(132) 苹果(120) 常州爱上学教育科技(79)
2002出願(5208) 邱则有(373) 松下电器产业(241) 索尼(120) 三星电子(118) 高通(117)	2007出願(7961) 华为技术(194) 高通(185) 三星电子(127) 索尼(120) 佳能(114)	2012出願(13001) 华为技术(341) 三星电子(264) 索尼(211) 佳能(147) 北京奇虎科技(143)	2017出願(6527) 华为技术(485) 广东欧珀移动通信(218) 大连大学(109) 六安永贞匠道机电科技(86) 东莞理工学院(82)
2003出願(7513) 邱则有(1391) 松下电器产业(295) 精工爱普生(134) 三星电子(133) 索尼(101)	2008出願(8443) 高通(223) 华为技术(184) 三星电子(154) 松下电器产业(117) 佳能(101)	2013出願(15262) 华为技术(445) 三星电子(311) 索尼(252) 英特尔(230) 佳能(151)	2018出願(2309) 华为技术(220) 广东欧珀移动通信(217) 腾讯科技(105) 上海寒武纪信息科技(47) 苹果(73)
2004出願(7703) 邱则有(969) 松下电器产业(279) 三星电子(202) 索尼(147) 精工爱普生(133)	2009出願(5279) 高通(269) 华为技术(145) 佳能(132) 三星电子(107) 苹果(90)	2014出願(15719) 华为技术(330) 索尼(220) 三星电子(220) 赵慧娜(136) 佳能(111)	2019出願(395) 腾讯科技(95) 广东欧珀移动通信(40) 杭州海康威视数字技术(36) 浙江舜宇光学(17) 仲从宝(11)

中国版 CNIPR や PATENTSCOPE には検索集合から出願人その他の情報を簡易解析する

機能が備わっており、簡単に出願人ランキングなどを表示できますが、これまでも指摘したように 1)、2)、このような簡易解析ツールでは出願人などの名寄せはされません。データベースに収録された出願人名をそのまま正確に（名寄せせずに）ランキング解析して抽出しますので注意が必要です。

例えば、中国版 CNIPR では 2000 年分割出願上位に索尼公司(SONY CORP)が 57 件と表示されますが、SONY CORP としては、索尼株式会社、索尼电脑、索尼计算机などの異表記もありますので名寄せをしてカウントすると 80 件となります。

表 2、表 3 では法人格を除いて表記していますが、原則、本体のみの分割出願数を示しています。「华为技术」では「华为技术服务」や「华为技术软件」などの関連会社も抽出してしまいますので本体のみを抽出するには「华为技术有限公司」とします。英語表記では「HUAWEI TECHNOLOGIES」ですが、「HUAWEI TECHNOLOGY」では「华卫科技」や「华微科技」などのノイズも混入します。

表 3. 5 年単位の分割出願 TOP10 出願人

2000-2004出願(26970)	2005-2009出願(40718)	2010-2014出願(67536)	2015-2019出願(48824)
邱则有(2733)	高通(1005)	华为技术(1501)	华为技术(1523)
松下电器产业(1247)	三星电子(875)	三星电子(1398)	OPPO(926)
索尼(561)	华为技术(762)	索尼(1133)	牟少奇(502)
三星电子(551)	松下电器产业(715)	英特尔(840)	三星电子(423)
精工爱普生(485)	索尼(597)	高通(727)	苹果(458)
高通(407)	佳能(490)	佳能(590)	LG电子(255)
半导体能源研究所(341)	邱则有(488)	戴梦云(558)	高通(237)
日立制作所(325)	半导体能源研究所(429)	LG电子(556)	佳能(231)
LG电子(315)	精工爱普生(358)	苹果(445)	合肥智慧龙图腾(171)
佳能(277)	英特尔(334)	精工爱普生(439)	腾讯科技(261)

2014 年分割出願までは华为技术有限公司、邱则有氏、戴梦云氏を除き、ほとんど外国出願人です。2004 年以降、中国出願件数 TOP を維持してきた华为技术有限公司の分割出願数も多いのが印象的。2015 年以降の分割出願は出願から日も浅いのでランキングは今後大きく変わることが予想されます。

表 3 において「OPPO」とあるのは、社名変更により 2018 年まで「广东欧珀移动通信」として、2016 年以降は「OPPO 广东移动通信」として出願している中国大手通信会社です。

表 3 と同様、5 年ごとに区切った分野別 IPC を表 4 に示しました。分割出願数の比較的多い分野の出願人のランキングも示しました。また、中国語表記ではわかりにくい外国出願人については英表記も付しました。

表 4. 5 年単位の分割出願 TOP10 IPC

2000-2004出願(26970)	2005-2009出願(40718)	2010-2014出願(67536)	2015-2019出願(48824)
E04B(2343)	A61P(4504)	A61P(6102)	H04L(2683)
A61P(2697)	H01L(2857)	H04N(4746)	G06F(2585)
H01L(1884)	H04W(2738)	G06F(4573)	H04W(2318)
H04L(1550)	H04L(2710)	H01L(3936)	H01L(1987)
H04N(1548)	G06F(2087)	H04W(3792)	A61P(1575)
G11B(1419)	H04N(1767)	H04L(3729)	H04N(1487)
E04C(1351)	C12N(1648)	C12N(2170)	G02B(1260)
G06F(1315)	G02F(883)	A61B(1959)	G01N(1160)
C12N(967)	G11B(727)	G01N(1898)	A61B(998)
G02F(786)	A01P(571)	G02B(1652)	C12N(816)

2000 年以降の出願人、IPC を概観すると電気・通信関係分野の出願が多いと言えるでしょう。2)以下には 2000～2019 年を通じた各分野の分割出願 TOP5 出願人を示した。

- 1) E04(建築)は建設会社の社長でもある邱则有氏の出願によるものです。(参考③)
- 2) A61P(化合物または医薬製剤の特殊な治療活性)は全年代にわたってかなりの分割出願数となっていますが、突出した出願(分割)をしている出願人はいません。
 - ・ 诺瓦提斯(277) ・・NOVARTIS (誤表記含め 11 種の異表記)
 - ・ 霍夫曼-拉罗奇(173) ・・HOFFMANN LA ROCHE (誤表記含め 31 種の異表記)
 - ・ 大塚制药(88)
 - ・ 青岛华之草医药科技(88)
 - ・ 济南帅华医药科技(69)
- 3) G06F(デジタルデータ処理)
 - ・ 英特尔(647) ・・INTEL
 - ・ 苹果(638) ・・APPLE INC
 - ・ 三星电子(528)
 - ・ 华为技术(317) ・・HUAWEI TECHNOLOGIES
 - ・ 北京奇虎科技(268) ・・BEIJING QIHOO TECHNOLOGY
- 4) H04L(デジタル情報伝送)
 - ・ 华为技术(1733)
 - ・ 高通(849) ・・QUALCOMM INCORPORATED (6 種の異表記)
 - ・ 三星电子(668)
 - ・ LG 电子(330)
 - ・ 英特尔(310)

5) H04N(画像通信)

- ・三星电子(831)
- ・索尼(639) ・ ・ SONY CORPORATION
- ・佳能(512) ・ ・ CANON KABUSHIKI KAISHA
- ・松下电器产业(420)
- ・夏普(279) ・ ・ SHARP KABUSHIKI KAISHA

6) H04W(無線通信ネットワーク)

- ・华为技术(1923)
- ・高通(1067)
- ・三星电子(466)
- ・OPPO 广东移动通信(432)
- ・日本电气(286)

実用新案についても同様に見ておきましょう。

表 5. 2011-2020 年実用新案分割出願／出願人・IPC TOP10

2011-2020出願(3454)		
出願人	IPC	
苹果(100)	F21V(140)	照明装置
久保田(84)	H02J(137)	電力回路
嘉兴山蒲照明电器(77)	G06F(124)	デジタルデータ処理
超越时空模具(53)	F21Y(118)	照明装置(光源の形状・種類)
半导体元件工业(46)	H04N(79)	画像通信
江苏省电力(46)	G06K(79)	記録担体
村田制作所(45)	A47J(78)	台所用具
日照钢铁控股(43)	A01D(71)	収穫
日本电产(37)	H01P(38)	導波管
黄效红(35)	F24H(38)	流体加熱器

3. 分割出願維持率等

2000～2020 年に出願された分割出願について分割以外の通常出願との対比を分野を問わず、分割特許 TOP20 出願人を表 6 に、分割実用新案 TOP10 出願人を表 7 に示しました。ここでも 5 年毎などに区切れば最近の動向なども把握できるかと思いますが参考情報として見ていただければ幸いです。2021 年 3 月現在の有効分割出願数でランキングしました。

分割までして出願した（重要な）特許・実用新案なので全出願より維持率が高いと予想しましたが、特許はわずかに分割の維持率が高い程度ですが、実用新案は予想通り高めの維持率ではないかと思えます。

表 6. 分割出願 TOP 20 (特許)

	全出願				分割出願				
	公開	登録	有効	維持率	公開	登録	有効	維持率	分割率
三星电子	43,635	20,700	14,399	70%	3,009	1,546	1,379	89%	7%
华为技术	69,409	41,372	32,801	79%	3,036	1,327	1,281	97%	4%
高通	20,383	11,736	9,530	81%	2,163	1,273	1,138	89%	11%
松下电器产业	33,374	20,116	11,692	58%	2,301	1,480	983	66%	7%
索尼	26,961	15,289	8,045	53%	2,210	1,210	858	71%	8%
佳能	18,332	13,294	9,497	71%	1,481	985	721	73%	8%
LG电子	17,598	12,124	7,496	62%	1,314	874	706	81%	7%
半导体能源研究	3,851	3,057	2,198	72%	1,225	901	659	73%	32%
精工爱普生	15,984	9,902	7,085	72%	1,363	887	648	73%	9%
英特尔	15,055	8,749	5,987	68%	1,466	757	586	77%	10%
苹果	4,703	2,817	2,714	96%	1,004	494	482	98%	21%
夏晋	14,956	9,116	6,651	73%	957	618	478	77%	6%
三菱电机	17,918	11,604	9,176	79%	810	539	464	86%	5%
株式会社东芝	15,044	7,800	4,329	56%	881	487	348	71%	6%
日立制作所	9,066	6,162	3,530	57%	738	515	315	61%	8%
日本电气	9,026	5,123	2,667	52%	773	383	295	77%	9%
北京奇虎科技	9,087	3,895	3,891	100%	388	258	258	100%	4%
富士通	8,538	4,904	2,291	47%	617	373	229	61%	7%
邱则有	5,045	2,022	408	20%	3,225	1,223	212	17%	64%
OPPO	24,696	8,727	8,727	100%	573	188	188	100%	2%

維持率：登録特許に対する有効（生きている）特許

分割率：全出願に対する分割特許

表 7. 分割出願 TOP 10 (実用新案)

	全出願			分割出願			
	登録	有効	維持率	登録	有効	維持率	分割率
嘉兴山蒲照明	214	214	100%	83	83	100%	39%
苹果	1016	829	82%	84	79	94%	8%
久保田	718	636	89%	75	73	97%	10%
日照钢铁控股	290	273	94%	49	49	100%	17%
村田制作所	943	932	99%	47	47	100%	5%
半导体元件工业	565	552	98%	46	46	100%	8%
日本电产	1860	1578	85%	46	46	100%	2%
江苏省电力	6204	4302	69%	49	39	80%	1%
湖南华强电气	82	64	78%	28	13	46%	34%
超越时空模具	92	6	7%	53	4	8%	58%

いずれも 2021/3/20 現在の情報であり、出願年基準のデータなのでデータが更新されるたびにいくらか変化するので時間経過して見る時には改めて最新情報を取得するなどの方がいいでしょう。

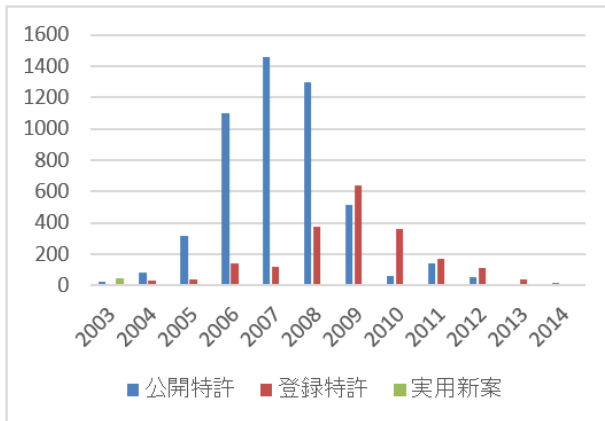
参考①：遅延公開特許推移

	出願年	2001		2002		2003		2010		2011		2012	
公開年	出願公開数	68,215		89,707		120,454		368,627		472,137		598,182	
	公開件数		分割		分割		分割		分割		分割		分割
2001年	50,364	8,144	0										
2002年	58,984	23,786	6	8,950	0								
2003年	77,472	23,929	15	32,989	8	14,146	0						
2004年	93,944	7,929	349	29,724	144	42,692	23						
2005年	155,446	1,998	905	13,126	684	46,650	269						
2006年	172,424	869	790	1,780	1,306	10,391	1,158						
2007年	208,345	577	552	1,159	1,118	2,545	2,176						
2008年	241,182	325	321	695	688	1,468	1,409						
2009年	281,006	294	289	548	535	932	884						
2010年	315,836	143	137	372	364	764	732	93,811	4				
2011年	368,434	84	83	139	139	325	325	142,508	124	113,822	19		
2012年	543,296	60	60	98	97	244	244	117,064	739	215,186	239	195,410	19
2013年	632,585	24	24	58	58	144	143	7,278	1,060	124,645	905	231,250	390
2014年	777,335	20	20	33	33	64	64	2,008	1,832	9,287	1,255	153,467	1,066
2015年	955,341	20	20	12	11	32	32	2,726	2,721	2,628	2,572	8,408	2,142
2016年	1,045,796	7	7	8	8	33	33	1,849	1,845	3,451	3,437	2,853	2,761
2017年	1,270,654	2	2	9	9	11	11	952	848	1,913	1,688	3,309	2,728
2018年	1,576,616	1	0	4	0	7	0	247	0	810	0	2,165	0
2019年	1,532,682	2	0	1	0	3	0	137	0	280	0	1,066	0
2020年	1,517,110	1	0	2	0	1	0	44	0	107	0	243	0

参考②：遅延登録実用新案推移

	出願年	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
登録年	出願登録数	343,024		485,469		627,027		641,978		703,789		947,742	
	登録件数		分割		分割		分割		分割		分割		分割
2010年	315,832	76,304	0										
2011年	404,520	263,410	59	134,408	0								
2012年	539,762	2,888	48	346,965	94	189,689	1						
2013年	734,041	376	13	3,767	64	435,765	123	294,079	2				
2014年	700,577	39	9	284	19	1,145	35	345,108	178	353,993	43		
2015年	859,925	1	0	35	3	376	20	2,372	57	348,254	306	508,886	126
2016年	918,455	6	5	9	1	41	5	342	6	1,121	45	436,298	478
2017年	973,473	0	0	0	0	9	0	69	6	335	22	1,910	59
2018年	1,479,346	0	0	0	0	2	0	2	0	76	0	466	0
2019年	1,582,473	0	0	1	0	0	0	1	0	9	0	170	0
2020年	2,377,461	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0

参考③：「邱则有」氏の出願推移（横軸：公報発行年）



参考文献

1) 中国特許統計データを読む際の留意点

https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201210/jpaapatent201210_060-070.pdf

2) PATENTSCOPE による中国特許調査

http://patentsearch.punyu.jp/asia/2018_2ito.pdf

以上